

高周波誘導加熱真空溶解炉 SVM-500R



高周波誘導加熱真空溶解炉SVM-500Rは誘導加熱式溶解炉で、鉄換算500gの容量まで溶解可能です。高周波電源は10kW15～30kHz仕様を採用し、溶解時間の短縮を実現しております。添加バケットを2個標準装備し、溶解中の温度監視が出来る様、熱電対も標準装備しております。連成計にて加圧の監視も可能で、大気溶解も可能です。本装置の最大の特徴は、高周波電源・加熱コイル用の循環式水冷却装置を標準装備しており、研究室のユーティリティ環境に配慮しております。貴社・貴学のご要望に合わせて設計・製作可能ですので是非御相談ください。

高周波誘導加熱真空溶解炉SVM-500R仕様

- 到達圧力 5.0×10⁻³Pa以下
※常温・無負荷・脱ガス・炉体無挿入時
- 溶解量 500g(鉄換算)
- 加熱温度 ~1900℃
- 溶解室径 φ450mm×500mmH SUS304
- 溶解機構 10kW15～30kHz
IGBT方式高周波電源
マッチングボックス
高周波同軸電極
溶解コイル：φ90mm×130mmH/12巻(Cu)
ルツボ形状：
φ60mm×φ48mm×150mmH(ZrO₂)
φ85mm×φ70mm×130mmH(Al₂O₃)
- 付帯機構 炉体傾注機構：手動ハンドル型
ブリッジブレーカー(先端部：W)
試料添加バケット：φ40mm×45mmH(2式)
測温機構：W-Re5-26熱電対/温度計
水冷鑄型：SUS304/一本取
- 真空排気系 油回転ポンプ：336L/min[50Hz]
油拡散ポンプ：1100L/sec水冷バツフル付
- 真空計 大気圧検知器/連成計(-0.10MPa～0～0.10MPa)/ガイスラー真空計/ペニング真空計
- 循環式水冷却装置 冷却能力：9.0kW[50Hz]
- ユーティリティ電気：AC200V三相20kVA
冷却水：20L/min以上0.2MPa以上0.25MPa以下25℃以下循環
- 寸法 装置架台本体：1300mmW×1000mmD×(2100mm)H
制御盤：570mmW×710mmD×1600mmH
循環式水冷却装置：600mmW×750mmD×(1405mm)H

